

(12) 特許協力条約に基づいて公開された国際出願

(19) 世界知的所有権機関
国際事務局

(43) 国際公開日
2023年2月9日(09.02.2023)



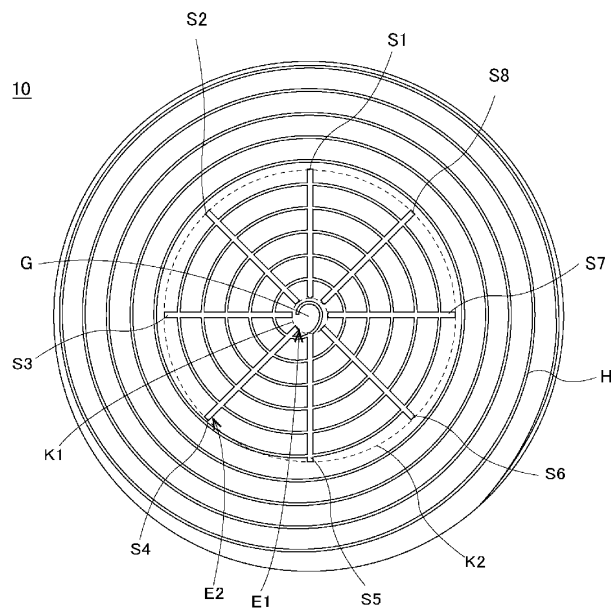
(10) 国際公開番号

WO 2023/013576 A1

- (51) 国際特許分類:
B24B 37/26 (2012.01) *H01L 21/304* (2006.01)
B24B 37/24 (2012.01)
- (21) 国際出願番号: PCT/JP2022/029479
- (22) 国際出願日: 2022年8月1日(01.08.2022)
- (25) 国際出願の言語: 日本語
- (26) 国際公開の言語: 日本語
- (30) 優先権データ:
特願 2021-128004 2021年8月4日(04.08.2021) JP
- (71) 出願人: 株式会社クラレ (KURARAY CO., LTD.) [JP/JP]; 〒7100801 岡山県倉敷市酒津1621 Okayama (JP).
- (72) 発明者: 砂山 梓紗 (SUNAYAMA Azusa); 〒7138550 岡山県倉敷市玉島乙島7471番地 株式会社クラレ内 Okayama (JP). 加藤 充 (KATO Mitsuru); 〒7138550 岡山県倉敷市玉島乙島7471番地 株式会社クラレ内 Okayama (JP). 竹越 穰 (TAKEGOSHI Minori); 〒7138550 岡山県倉敷市玉島乙島7471番地 株式会社クラレ内 Okayama (JP).
- (74) 代理人: 江川 勝 (EGAWA Masaru); 〒5940071 大阪府和泉市府中町7丁目4番18号 サンビル2階 江川特許事務所 Osaka (JP).
- (81) 指定国(表示のない限り、全ての種類の国内保護が可能): AE, AG, AL, AM, AO, AT, AU, AZ, BA, BB, BG, BH, BN, BR, BW, BY, BZ, CA, CH,

(54) Title: POLISHING PAD

(54) 発明の名称: 研磨パッド



(57) Abstract: This polishing pad has a polishing layer having a circular polishing surface, and is also provided with a spiral groove or concentric circular grooves consisting of a plurality of annular grooves arranged in concentric circles and formed spanning from a central region of the polishing surface to a circumferential edge region, and radiating grooves consisting of line segment grooves extending from the central region toward the circumferential edge region. The line segment grooves have first end sections in a region at a distance 5-10% of the

[続葉有]

CL, CN, CO, CR, CU, CV, CZ, DE, DJ, DK, DM, DO,
DZ, EC, EE, EG, ES, FI, GB, GD, GE, GH, GM, GT,
HN, HR, HU, ID, IL, IN, IQ, IR, IS, IT, JM, JO, JP,
KE, KG, KH, KN, KP, KR, KW, KZ, LA, LC, LK,
LR, LS, LU, LY, MA, MD, ME, MG, MK, MN, MW,
MX, MY, MZ, NA, NG, NI, NO, NZ, OM, PA, PE,
PG, PH, PL, PT, QA, RO, RS, RU, RW, SA, SC, SD,
SE, SG, SK, SL, ST, SV, SY, TH, TJ, TM, TN, TR, TT,
TZ, UA, UG, US, UZ, VC, VN, WS, ZA, ZM, ZW.

- (84) 指定国(表示のない限り、全ての種類の広域保護が可能): ARIPO (BW, GH, GM, KE, LR, LS, MW, MZ, NA, RW, SD, SL, ST, SZ, TZ, UG, ZM, ZW), ユーラシア (AM, AZ, BY, KG, KZ, RU, TJ, TM), ヨーロッパ (AL, AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HR, HU, IE, IS, IT, LT, LU, LV, MC, MK, MT, NL, NO, PL, PT, RO, RS, SE, SI, SK, SM, TR), OAPI (BF, BJ, CF, CG, CI, CM, GA, GN, GQ, GW, KM, ML, MR, NE, SN, TD, TG).

添付公開書類:

一 国際調査報告 (条約第21条(3))

radius of the polishing surface from the center of the radiating grooves and have second end sections in a region at a distance 35-70% of the radius of the polishing surface from the center of the radiating grooves. The line segment grooves have an average length that is a 30-65% proportion of the radius of the polishing surface. A cross-sectional area S_a (mm^2) of the line segment grooves and a cross-sectional area S_b (mm^2) of the spiral groove or concentric circular grooves satisfy the formula $0.1 \leq S_b/S_a < 1.0$.

(57) 要約: 円形の研磨面を有する研磨層を備え、研磨面の中央領域から周縁領域に渡って形成された、螺旋状溝又は同心円状に配置された複数の環状溝からなる同心円状溝と、中央領域から周縁領域に向かって延びる線分状溝からなる放射溝と、を備える研磨パッドである。そして、線分状溝は、放射溝中心から研磨面の半径に対して5~10%の距離の領域に第1の端部を有し、放射溝中心から研磨面の半径に対して35~70%の距離の領域に第2の端部を有し、線分状溝が、研磨面の半径に対して30~65%の割合の平均長さを有する。そして、線分状溝の断面積 S_a (mm^2) と、螺旋状溝又は同心円状溝の断面積 S_b (mm^2) とが、 $0.1 \leq S_b/S_a < 1.0$ を満たす。